

## О РОЛИ ФОТОАКТИВНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ СОБСТВЕННОЙ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ В ПОЛОСКОВЫХ МНОГОПРОХОДНЫХ ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ

Адамсон П. В.

Теоретически рассмотрено влияние переизлучения (перепоглощения) собственной люминесценции на пороговый уровень накачки в полупроводниковых лазерах на основе полосковых многопроходных гетероструктур с полностью поглощающими боковыми поверхностями. Рассчитаны зависимости снижения уровня пороговой накачки от ширины и толщины активного слоя лазера.

Создание совершенных полупроводниковых гетероструктур с внутренним квантовым выходом люминесценции, близким к 100 % [<sup>1</sup>], открыло путь к использованию явления переизлучения (перепоглощения) собственной люминесценции в многопроходных гетероструктурах [<sup>2-4</sup>] для улучшения характеристик оптоэлектронных устройств. Например, применение этого явления в светоизделях привело к существенному повышению их эффективности [<sup>5</sup>]. Поскольку технология многопроходных структур весьма сложна и некоторые ее аспекты, в частности получение высокоотражающих омических контактов, еще требуют своего решения, предварительный теоретический анализ эффекта переизлучения в разных конфигурациях многопроходных структур представляет значительный интерес. Однако известные расчеты [<sup>2-4, 6</sup>] проведены в рамках модели планарной бесконечно протяженной в двух измерениях структуры. В то же время на практике, особенно для гетеролазеров, зачастую основную ценность представляют лишь полосковые структуры. Поэтому цель данной работы — выяснение эффективности перепоглощения люминесценции в полосковых многопроходных гетероструктурах. Делается это на примере полосковых гетеролазеров, но развитая методика расчета, разумеется, применима и для других оптоэлектронных приборов.

Рассмотрим полосковую симметричную лазерную структуру [общей толщиной  $D = d_a + 2d_p$  ( $d_a$  и  $d_p$  — толщины активного и пассивных слоев) и шириной активного слоя  $S$  (рис. 1, a)] без подложки и контактного слоя и нанесенными хорошо отражающими свет омическими контактами непосредственно на эмиттеры. В такой структуре возникает эффект переизлучения, состоящий в том, что часть излучаемого активным слоем спонтанного излучения после отражений на контактах частично снова перепоглощается и затем переизлучается в активном слое. Исследуем это явление количественно в случае полностью поглощающих боковых поверхностей.

Пусть каждый элемент объема активного слоя излучает равномерно по всем направлениям некогерентный и неполяризованный свет со спектральной интенсивностью  $\psi/2 = \psi^{TE} = \psi^{TM}$ , где  $\psi^{TE}$ ,  $\psi^{TM}$  — интенсивности двух перпендикулярно поляризованных ( $TE$  и  $TM$ ) излучений. Для расчета потока света, который перепоглощается в активном слое, рассмотрим ход световых пучков с определенной поляризацией  $\sigma = TE$  или  $TM$  с элемента площади  $Sdz$ , распространяющихся в элементах телесного угла  $\sin \theta d\theta d\phi$  под углами  $\theta$  и  $\varphi$  к осям  $x$  и  $y$  соответственно. При этом считаем, что длина структуры бесконечная,  $d_a \ll D$ , границы раздела между слоями  $p$  и  $s$  являются зеркальными поверхностями, отражающими свет, согласно формулам Френеля, и показатели преломления  $n_a$  (активного) и  $n_p$  (пассивного) слоев отличаются слабо (если  $n_a \approx n_p$ , то в области углов

$\theta < \theta_c$ , где  $\theta_c$  — угол полного внутреннего отражения, преломлением и отражением на внутренних границах раздела слоев  $a$  и  $p$  можно пренебречь). Тогда при первом прохождении активного слоя в нем перепоглощается световой поток

$$d^3F_1 = \frac{\Phi S dz}{8\pi} \sin \theta d\theta d\varphi (1 - M_a \cos \theta) \chi_a d_a, \quad (1)$$

где  $M_a = \exp(-\chi_a d_a / \cos \theta)$ ,  $\chi_a$  — коэффициент резонансного поглощения в активном слое. Далее удобно воспользоваться разверткой ломаного луча в пря-

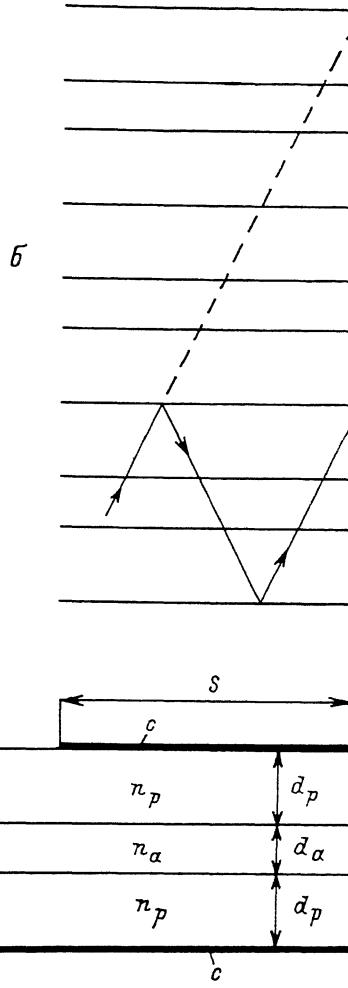


Рис. 1. Поперечный разрыв многопроходной полосковой структуры.

$a$  — активный слой,  $p$  — пассивные слои,  $c$  — отражающие покрытия (а) и схема развертки ломаного луча в прямую линию (б).

мую линию (рис. 1, б). Как видно, вторично через активный слой проходит только световой поток с шириной  $S - D \operatorname{tg} \theta \cos \varphi$ , и, следовательно, перепоглощается поток

$$d^3F_2 = \frac{\Phi S dz}{8\pi \chi_a} \cos \theta \sin \theta d\theta d\varphi M_p^2 (1 - M_a)^2 (1 - t) R^*, \quad (2)$$

где

$$t = DS^{-1} \operatorname{tg} \theta \cos \varphi, \quad M_p = \exp(-\chi_p d_p / \cos \theta),$$

$\chi_p$  — коэффициент потерь в пассивных слоях,  $R^*$  — коэффициент отражения на внешних покрытиях.

Аналогично получим, что при  $n-m$  прохождении перепоглощается в активном слое световой поток

$$d^3F_n^\sigma = \frac{\psi S dz}{8\pi x_a} \cos \theta \sin \theta d\theta d\varphi M_a (1 - M_a)^2 (1 - (n-1)t) (\rho^\sigma)^{n-1}, \quad (3)$$

где  $\rho^\sigma = M_a M_p^2 R^\sigma$ . Таким образом, вообще перепоглощается поток

$$\sum_n d^3F^\sigma = \sum_n d^3F_n^\sigma = \frac{\psi S dz d\theta}{8\pi} \sin \theta d\theta d\varphi (1 - \eta^\sigma(\theta, \varphi)), \quad (4)$$

$$\eta^\sigma(\theta, \varphi) = \frac{\cos \theta (1 - M_a)}{x_a d_a M_a} \left\{ 1 - (1 - M_a) \sum_{n=1}^N (1 - (n-1)t) (\rho^\sigma)^{n-1} \right\}, \quad (5)$$

где  $N = [t^{-1} + 1]$ ,  $[ ]$  — знак целой части. Величина  $\eta^\sigma$  представляет собой относительную часть светового потока, которая поглощается вне активного слоя или выходит через боковые поверхности. Поскольку

$$\sum_{n=1}^N (1 - (n-1)t) (\rho^\sigma)^{n-1} = \left( 1 - t\rho^\sigma \frac{d}{d\rho^\sigma} \right) \sum_{n=0}^{N-1} (\rho^\sigma)^n = \left( 1 - t\rho^\sigma \frac{d}{d\rho^\sigma} \right) \left( \frac{1 - (\rho^\sigma)^N}{1 - \rho^\sigma} \right), \quad (6)$$

$\eta^\sigma$  можно представить в виде

$$\begin{aligned} \eta^\sigma = \frac{\cos \theta}{x_a d_a} (1 - M_a) & \left\{ \frac{1 - M_p^2 R^\sigma}{1 - \rho^\sigma} + \frac{M_p^2 R^\sigma (1 - M_p^2)}{(1 - \rho^\sigma)^2} [t + (1 - tN) (\rho^\sigma)^{N-1} + \right. \\ & \left. + (t(N-1)-1) (\rho^\sigma)^N] \right\}. \end{aligned} \quad (7)$$

Суммируя по поляризациям и всем направлениям, т. е. интегрируя по углам  $\theta$  и  $\varphi$ , получим, что потери излучения вне активного слоя на единицу объема этого слоя равны

$$\Pi = \frac{\psi}{\pi} \int_0^{\theta_c} d\theta \int_0^{\pi/2} d\varphi \sin \theta (\eta^{TE} + \eta^{TM}). \quad (8)$$

В гетеролазерах переизлучение спонтанной люминесценции в первую очередь приводит к снижению порогового уровня накачки (в частности, инжекционного тока). Если усиленной люминесценцией можно пренебречь (соответствующие условия представлены в [6]), то отношение радиационных потерь в лазерах без отражающих покрытий к соответствующей величине в лазерах с отражающими покрытиями на эмиттерах ( $f$ ), показывающее, во сколько раз может быть понижен уровень накачки, если внутренний квантовый выход люминесценции  $\beta$  в активном слое равен единице, выражается следующим образом:

$$f = \int_{\omega_g}^{\infty} \Pi_0(\omega) d\omega \left( \int_{\omega_g}^{\infty} \Pi(\omega) d\omega \right)^{-1}, \quad (9)$$

где  $\omega_g = E_g/\hbar$ ,  $E_g$  — ширина запрещенной зоны активного материала. Величина  $\Pi_0$  в (9) определяется формулой (8), где взято  $R^\sigma \equiv 0$ . [Если  $\beta < 1$ , то пороговая накачка снижается в  $f(\beta + f(1-\beta))^{-1}$  раз].

Расчеты величины  $f$  проводились для гетеролазеров на основе системы AlAs—GaAs с нелегированными активными слоями при комнатной температуре. Спектры коэффициента поглощения (усиления)  $x_a(\omega)$  и спонтанной люминесценции  $\psi(\omega)$  рассчитывались в рамках модели прямых оптических переходов [7] при уровне возбуждения, где максимальный коэффициент усиления в активном слое равен  $50 \text{ см}^{-1}$ . Учитывались одна зона проводимости и одна валентная зона с параболическими законами дисперсии. Матричный элемент дипольного перехода рассчитывался в рамках модели Кейна [8]. В качестве высокоотражающих покрытий выступали благородный металл серебро [9] и внешняя граница полупроводник—воздух (гетеролазеры с оптической накачкой), для показателей преломления внутренних слоев применялись значения  $n_a = 3.6$  и  $n_p = 3.4$ .

Результаты расчета показывают, что влияние эффекта переизлучения проявляется только тогда, когда ширина структуры значительно превосходит ее

